ナノスケール・シリコンにおける電子・電子散乱を利用した エレクトロン・アスピレーター

Electron Aspirator using Electron-Electron Scattering in Nanoscale Silicon

静大電研¹, 静大院創造², 北大院情報³, NTT 物性基礎研⁴ ○小野 行徳^{1,2}, ヒンマ フィルダス², 渡邉 時暢¹, 堀 匡寛^{1,2}, ダニエル モラル^{1,2} 高橋 庸夫³, 藤原 聡⁴
RIE Shizuoka Univ.¹, GSST Shizuoka Univ.², Hokkaido Univ.³, NTT BRL⁴

°Y. Ono^{1,2}, H. Firdaus², T. Watanabe¹, M. Hori^{1,2}, D. Moraru^{1,2}, Y. Takahashi³, A. Fujiwara⁴
E-mail: ono.yukinori@shizuoka.ac.jp

ナノスケールの MOS トランジスタにおける電流量(駆動力)は、ソース端での電流注入量とソース近傍チャネルにおける反跳散乱の大きさによって決まる[1]。一方、ソース領域を通過した電子の運動量とエネルギーは、ドレイン端で不可避的に散逸することになり、このことが MOS トランジスタの駆動力とエネルギー効率を律速する本質的な問題となっている。ここでは、このような MOS トランジスタの原理的限界を打破するために、付加的な電源電圧なしにトランジスタ電流を増幅できる(すなわち、トランジスタの駆動力を向上させることができる)ナノスケールMOS デバイス:エレクトロン・アスピレーターを提案し、その基本動作を実証した[2]。

図 1a, 1bにデバイス構造と SEM 像を示す。同デバイスは、エミッタ、コレクタ、ベースの三つの電流端子を有し、エミッタゲートは通常のトランジスタゲートとして機能し、コレクタゲートはコレクタ電流制御のために用いられる。図 1cに示すように、エミッターゲート下を通過した電子の運動量とエネルギーは、T字型分岐領域(トランジスタのドレイン端に相当)において、格子系に散逸される前に電子・電子散乱によって他の多くの電子に移送される。これにより新たにベースから電子が引き込まれ、エミッタ電流が増幅される。この効果は、流体力学におけるベルヌーイのポンプ効果[3]に相当するものである。図 2にコレクタ電流とベース電流のエミッタゲート依存性を示す(測定温度 8K)。アスピレーターモード(ベース接地)での動作(赤と青の実線)では、ベースから電子が逆流し、これによりコレクタ電流が、トランジスタモード(ベース電流をゼロにバイアス)での動作(赤の点線)に比して増加していることがわかる。この電流増幅には、通常のトランジスタ動作では不可避的に格子系に散逸してしまう、入射電子のエネルギーが用いられており、このことは、同デバイスが従来型デバイスの原理的限界を超えて多くの「仕事」をしていることを意味している。

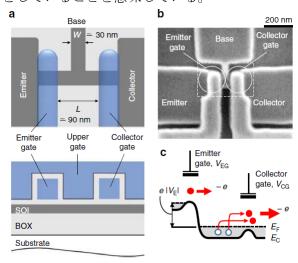


Figure 1. Schematic top and cross-sectional views **a**, SEM image **b**, and potential diagram **c** of the device, fabricated on an SOI substrate.

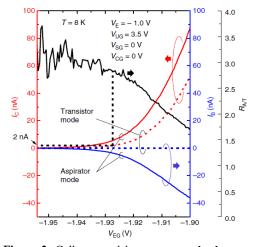


Figure 2. Collector and base currents, $I_{\rm C}$, $I_{\rm B}$ as a function of the emitter-gate voltage $V_{\rm EG}$ for the aspirator mode (solid lines) and the transistor mode (dotted lines). Black line, $R_{\rm A/T}$, shows the ratio of the collector currents of the two modes.

本研究は、科研費(JP15H01706, JP16H04339, JP16H02339, JP16H06087, JP17H06211, JP18H05258, JP18K13803)の支援を得て行われた。

参考文献

[1] M. Lundstrom, *IEEE Electron. Dev. Lett.* **18**, 361 (1997). [2] H. Firdaus et al., *Nat. commun.* **9**, 4813 (2018).

[3] A. O. Govorov & J. J. Heremans, *Phys. Rev. Lett.* **92**, 026803 (2004).